

平成29年度 第2回 電子デバイス事業化フォーラム 開催報告

平成29年9月2日(土)、福山市の福山商工会議所において第2回電子デバイス事業化フォーラムを開催しました。このフォーラムは、中国地域の電子産業分野の企業が多数集積する備後地域を中心に、電子デバイス関係技術の更なる伸張と、最新情報の交換、技術交流を通じた地域のネットワークの拡充を図ろうとするものです。

第1回のフォーラムではグローバルな視点から「世界半導体および周辺産業の現状と将来展望」を取り上げましたが、第2回は、「最先端半導体デバイス技術の動向」をテーマとして、コンピュータの歴史から最先端の近接場結合集積技術について慶應義塾大学理工学部電子工学科の黒田教授より「脳・AI・3D集積ーシリコン脳を創るー」と題して、ご講演をいただきました。次に、長年に渡って、集積回路の研究に携わってこられた東京工業大学科学技術創成研究院未来産業技術研究所の岩井名誉教授より微細化の限界や遠未来のバイオテクノロジーについて「微細化終焉後の電子デバイス技術の将来ーその過去・現状と22世紀までの見通しー」と題して、ご講演をいただきました。そして、今回の大学のシーズ紹介は、自動車ワイヤーハーネスや電力ケーブル絶縁材に用いられる架橋ポリオレフィン樹脂の最新の材料開発研究や電池材料の評価方法を研究されている山口大学大学院創成科学研究科の安達准教授より「自動車部材・電子材料開発に資するシーズ技術紹介」と題して、ご紹介をいただきました。

今回も多くの皆さまにご参加いただき、新技術への驚きや未来技術の方向性に対して、大変参考になったと好評の声を多くいただきました。

【開催概要】

日 時 平成29年9月2日(土) 13:30~17:00
場 所 福山商工会議所 101会議室(福山市西町2-10-1)
主 催 公益財団法人 ちゅうごく産業創造センター/中国経済産業局/備後半導体技術推進連合会
参 加 者 91名

【プログラム】 司 会: (公財)ちゅうごく産業創造センター コーディネーター: 名雪 稔

- (1) 開会挨拶: (公財)ちゅうごく産業創造センター 専務理事: 増矢 学
- (2) 講演1: 題目 「脳・AI・3D集積ーシリコン脳を創るー」
講師 慶應義塾大学 理工学部電子工学科 教授 黒田 忠広 氏
- (3) 講演2: 題目 「微細化終焉後の電子デバイス技術の将来ーその過去・現状と22世紀までの見通しー」
講師 東京工業大学 科学技術創成研究院 未来産業技術研究所名誉教授 岩井 洋 氏
- (4) 研究シーズ紹介: 題目 「自動車部材・電子材料開発に資するシーズ技術紹介
【湿気反応性高速硬化型樹脂化合物・単一微粒子体積磁化率測定】」
紹介者 山口大学大学院 創成科学研究科 准教授 安達 健太 氏
- (5) 閉会の挨拶: 備後半導体技術推進連合会(BISTEC)副会長 藤井 修逸

【会場風景】



(黒田氏)



(岩井氏)



(安達氏)



(会場全体)



この事業は、競輪の補助を受けて実施しました。

<http://hojo.keirin-autorace.or.jp/>